

函詢半導體製造業現地式處理設備是否應依「半導體製造業空氣污染管制及排放標準」規定紀錄申報之疑義一案

發文機關：行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處

發文字號：行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處 107.08.24.

環署空字第1070065151號

發文日期：民國107年8月24日

主旨：函詢半導體製造業現地式處理設備是否應依「半導體製造業空氣污染管制及排放標準」規定紀錄申報之疑義一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、依半導體製造業空氣污染管制及排放標準（以下簡稱排放標準）第6條第3款及第8款規定，污染防制設備為清水洗滌吸收設施者，應記錄保養維護事項，以確保潤濕因子及填充段空塔滯留時間符合設施規範，並每日記錄各洗滌槽洗滌循環水量及廢水排放流量；以其他污染防制設備處理者，應記錄保養維護事項，並每日記錄主要操作參數。
- 二、公私場所以現地式處理設備處理製程廢氣，再經後端濕式洗滌塔處理，因現地式處理設備及濕式洗滌塔皆屬污染防制設備，故應符合排放標準第6條相關紀錄、保存、檢測與申報之規定。倘公私場所使用現地式處理設備屬於清水洗滌吸收設施者，仍應依排放標準第6條第3項規定辦理。